

Т.М. РАЗЫКОВ¹, А.Х. ШУКУРОВ¹, К.М. КУЧКАРОВ¹,
Г.С. БОЛТАЕВ², Б.Р. КУТЛИМУРОТОВ², А.А. МАВЛОНОВ^{1,*}

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНКИХ ПЛЕНОК Sb₂Se₃, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ПАРОВОГО ОСАЖДЕНИЯ

Изготовлени тонкие пленки селенида сурьмы который является перспективным альтернативным фотовольтаическим поглощающим материалом, относящимся к тонкопленочным солнечным элементам Cu(In,Ga)Se₂ и CdTe. Тонкие пленки Sb₂Se₃ были осаждены методом химического парового осаждения (ХПО) на стеклянную подложку. Установлено, что температура осаждения влияет на морфологию пленок, а температура подложки ~ 400°C дает лучшее качество кристаллических структур (более плотные и однородные зерна с минимальными зазорами). После отжига основные кристаллические ориентации не изменились, а поверхность пленок стала более гладкой.

Введение

Среди нескольких неорганических селенидов металлов, селенид сурьмы (Sb_2Se_3) является перспективным фотоэлектрическим поглощающим материалом, из-за его высоких электрооптических свойств [1]. Например, Sb_2Se_3 имеет прямую запрещенную зону 1,1-1,3 эВ, высокий коэффициент поглощения ($> 10^5 \text{ см}^{-1}$) и довольно простой состав по сравнению с тонкопленочными солнечными элементами Cu(In,Ge)Se₂ [2, 3]. Кроме того, тонкопленочные солнечные элементы на основе Sb_2Se_3 были изготовлены с измеряемой эффективностью преобразования более 5% за последние 2-3 года [4, 5]. Поскольку слой Sb_2Se_3 является ключевым материалом для тонкопленочных солнечных элементов на основе Sb_2Se_3 , кристаллическая структура пленки имеет решающее значение. В литературе имеются данные о тонких пленках Sb_2Se_3 , которые осаждаются с использованием различных методов роста, например, тепловое испарение [6], газотранспортная epitаксия в потоке водорода [7], химическое жидкокристаллическое осаждение [8], магнетронное распыление [9], спин-покрытие [10] и т. д. В работе сообщается о тонких пленках Sb_2Se_3 , изготовленных методом химического парового осаждения [11].

Эксперимент

Исходный материал Sb_2Se_3 со стехиометрическим составом был приготовлен в закрытом кварцевом тигле, в вакууме путем нагревания его в печи в течение 8 час. при 630°C. Для этого использовались коммерчески доступные порошки Sb и Se. Этот исходный материал Sb_2Se_3 использовался для выращивания тонких пленок. При этом были использованы гранулы Sb и Se высокой чистоты 99,999%.

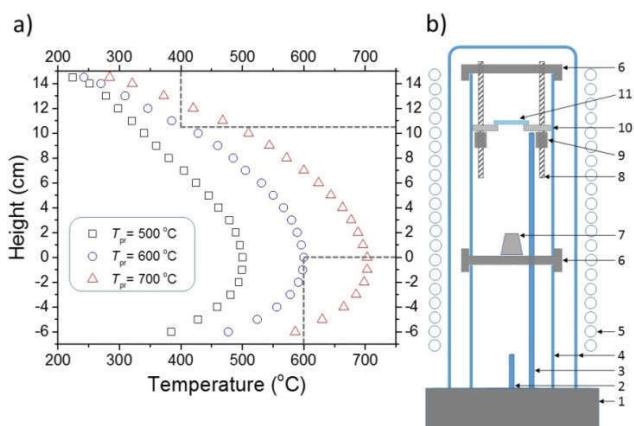


Рис. 1. (а) Изменение температуры вдоль вертикального направления установки для трех разных температур исходного материала при $T_p=500^\circ\text{C}$, 600°C и 700°C . Пунктирные линии изображают температуру исходного материала и подложки при 600°C и 400°C , соответственно. (б) Схематическая диаграмма квазизмкнутой установки: 1 - реактор, 2 - газовая трубка, 3 - термопара, 4 - кварц, 5 - нагреватель печи, 6 - графитовый держатель, 7 - исходный материал, 8 - держатель маски (Mo), 9 - держатель маски (графит), 10 - маска (Mo) и 11 - подложка. Примечание. В схеме показано, что исходный материал и подложка расположены в местах, где температура достигает 600°C и 400°C , соответственно (в сравнении с (а)).

Тонкая пленка Sb_2Se_3 выращивалась методом ХПО, под давлением водорода, на стеклянной подложке. Схемы роста и изменение температуры вдоль вертикального направления установки показаны на рис. 1. Все внутренние компоненты установки были изготовлены с использованием высокотемпературных стабильных материалов, кварца, графита и молибдена, чтобы избежать влияния непреднамеренных примесей в процессе роста. Так как температуры подложки (T_S) и исходного материала (T_P) зависят от их положения, то есть вдоль вертикального направления установки, держатель подложки и термопары установлены в определенном положении, их положение можно регулировать. В работе тонкопленочные Sb_2Se_3 были выращены при температуре подложки и исходного материала $T_S=400^{\circ}C$ и $T_P=630^{\circ}C$, соответственно.

Дифрактограммы рентгеновских лучей исходного материала Sb_2Se_3 и тонкой пленки получены на мощном дифрактометре УМ-1, с монохроматическим излучением CuKa. Морфология пленки наблюдалась с помощью атомного силового микроскопа (AFM, Solver Next, NT-MDT). Ширину запрещенной зоны оценивали по экспериментальным данным, полученным спектрофотометром (HR4000, Océan Optics).

Результаты и их обсуждение

Первоначальное измерение рентгеновской дифракции (XRD) проводилось для характеристики кристаллографической фазы исходного материала Sb_2Se_3 и пленки. На рис. 2 показаны рентгеновские дифрактограммы с углом 2θ для исходного материала Sb_2Se_3 , а также для выращенных и после отожженных пленок. Также для сравнения представлена карта JCPDS Sb_2Se_3 (JCPDS-00-015-0861). Как показано, исходный материал Sb_2Se_3 демонстрирует подобные пики, которые могут быть отнесены к орторомбическому Sb_2Se_3 . В частности, не были обнаружены явные примесные фазы, таких как Sb_2O_3 . Кроме того, образцы XRD показали, что пленка Sb_2Se_3 , полученная с использованием исходного материала Sb_2Se_3 , является поликристаллической. Выращенная пленка демонстрировала два пика, которые очень близки к (221) и (400) «пиковым» положениям. После термообработки эти пики остаются, хотя их интенсивность, как правило, уменьшается. Кроме того, в этой отожженной пленке начинают появляться другие мелкие пики, которые могут быть вызваны эффектом рекристаллизации.

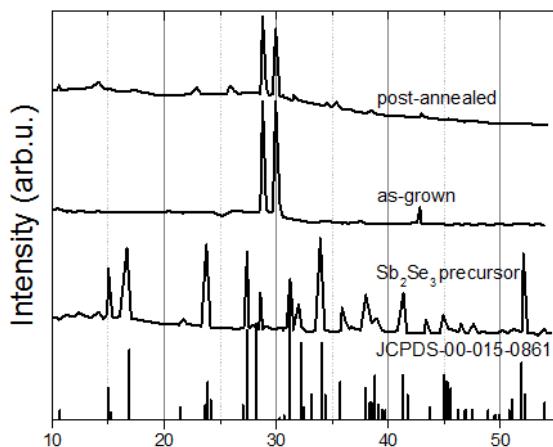


Рис. 2. Данные рентгеновской дифракции исходного материала Sb_2Se_3 и пленки до и после отжига. Для сравнения также приведены данные JCPDS Card (00-015-0861) Sb_2Se_3 .

Были исследованы морфология кристаллического строения выращенной пленки до и после отжига на атомно-силовом микроскопе, результаты показаны на рис. 3. Снимки пленки, полученные атомно-силовым микроскопом показывают два аспекта. Во-первых, на поверхностях выращенных пленок наблюдаются довольно плотно упакованные микроструктуры с несколькими пятнами (рис. 3a, b). Во-вторых, на отожженных пленках можно увидеть более однородное распределение и одинаковые размеры зерен с меньшим межкристаллитным расстоянием, к тому же эти зерна прозрачные. (рис. 3b). Это может быть признаком эффекта перекристаллизации после термообработки.

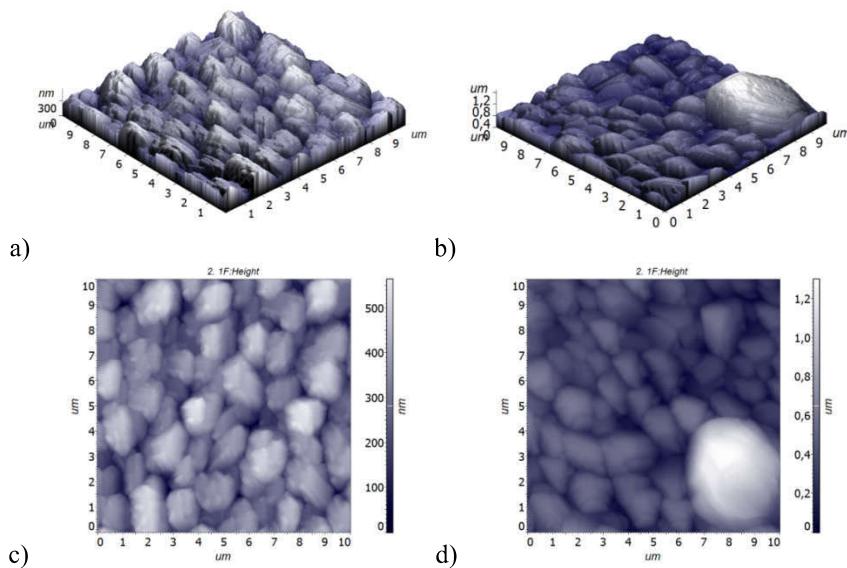


Рис. 3. Снимки тонкой пленки Sb_2Se_3 до (а, с) и после (б, д) отжига в воздухе при 300°C полученные на атомным силовом микроскопе причем (а) и (с), а также (б) и (д) представляют собой одни и тот же АФМ-снимки, но с 2D и 3D видами, соответственно.

На рис. 4 показана оптическая плотность выращенной тонкой пленки Sb_2Se_3 в зависимости от энергии падающего фотона. В общем, оптическая плотность является мерой поглощения материала. Оптическая плотность описывает долю входящего света, поглощаемого материалом. Она вычисляется по формуле:

$$OD = \log_{10} \frac{I_{\text{film}}}{I_0} \quad (1)$$

где, I_{film} и I_0 полученные с интенсивностью света, и с материалом на пути пучка и материалом, удаленным с пути пучка соответственно. Согласно уравнению 1, если материал позволяет пропускать $1/10$ входящего света, оптическая плотность равна 1. Если он пропускает $1/100$ входящего света, оптическая плотность равна 2 и т. д.

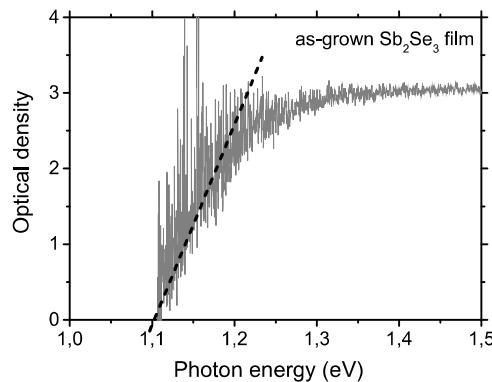


Рис. 4. Зависимость оптической плотности от энергии падающих фотонов для выращенной тонкой пленки Sb_2Se_3 . Пунктирная линия является разделом оптической ширины запрещенной зоны при $\sim 1,1$ эВ.

Как показано на рис. 4, с увеличением энергии фотонов поглощение в пленке быстро возрастает, что связано с переходом электронов между зонами. С другой стороны, это позволяет определить оптическую ширину запрещенной зоны, т.е. $\sim 1,1$ эВ, для выращенной тонкой пленки Sb_2Se_3 (см. пунктирную линию на рис. 4). В литературе имеется информация об аналогичном значении оптической ширины запрещенной зоны 1,15 эВ, которое, как было установлено, почти не зависит от температуры после отжига пленок [12]. Кроме того, Chen et al. подтвердил оптический переход-

ный тип с-Sb₂Se₃ по температурно-зависимому спектру пропускания (TDTS) и измерениям фотолюминесценции (TDPL), зависящим от температуры [2], обнаружено, что с-Sb₂Se₃ является непрямоизонным материалом, имеющим ширину запрещенной зоны (E_{g,i}) E_{g,i} (1,03 ± 0,01) эВ с наименьшей прямой зонной щелью E_g, ≈ (1,17 ± 0,02) эВ при 300 К.

Заключение

Изготовлены тонкие пленки Sb₂Se₃ с использованием не вакуумной технологии химического парового осаждения. Было показано, что тонкая пленка Sb₂Se₃ является поликристаллической до и после термообработки. Исследования морфологии поверхности пленки показывают, что имеется довольно плотно упакованная микроструктура на поверхности выращенной пленки и более однородное распределение размера зерна с образованием столбчатых зерен в пленках, после отжига. Оптические измерения показали, что тонкая пленка Sb₂Se₃ имеет оптическую ширину запрещенной зоны ~ 1,1 эВ, которая соответствует однопереходным солнечным элементам.

Авторы признательны А.С. Ачилову (Физико-технический институт), М. Адилову (Институт ИП и ЛТ) за техническую помощь, лаборатории М.К. Бахадырханова (ТГТУ) для подготовки прокурсоров, Ж.Ш. Турдиеву и С.Х. Бобоколову (Физико-технический институт) для за проведение рентгеновских измерений. Эта работа выполнена на основе гранта Академии наук Республики Узбекистан (№ FA-F3-003).

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Sun P., et al., Thermal evaporation of Sb₂Se₃ as novel counter electrode for dye-sensitized solar cells. Chemistry Select 1. 2016. V. 1. N 8. pp. 1824–1831. [2] Chen C., et al., Optical properties of amorphous and polycrystalline Sb₂Se₃ thin films prepared by thermal evaporation. Appl. Phys. Lett. 2015. V. 107, N 4. p. 043905(5). [3] Bajpeyee A. U., et al., Deposition and characterization of Antimony Selenide thin films. Multilogic in Science An International Refreed & Indexed Quarterly Journal. 2012. V. 2. N 2. pp. 38-43. [4] Liu X., et al., Improving the performance of Sb₂Se₃ thin film solar cells over 4% by controlled addition of oxygen during film deposition. Progress in Photovoltaics. 2015. V. 23. N 12. pp. 1828–1836. [5] Zakutayev A. Brief review of emerging photovoltaic absorber materials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 2017. V. 4. pp. 1-14. [6] Liu X., et al., Thermal evaporation and characterization of Sb₂Se₃ thin film for substrate Sb₂Se₃/CdS solar cells. ACS Applied Materials & Interfaces. 2014. V. 6. N 13. pp. 10687–10695. [7] Мирсагатов Ш.А., Атабоев О.К., Махмудов М.А., Атабоева Ф.К. Влияние ультразвукового облучения на выходные параметры светочувствительной гетероструктуры In-n⁺CdS-nCdS_xTe_{1-x}-pZn_xCd_{1-x}Te-Mo. Гелиотехника. 2016. №2. С. 45-49. [8] Kulkarni A. N., et al., Sb₂Se₃ sensitized heterojunction solar cells. Materials for Renewable and Sustainable Energy. 2015. V. 4. N 15. pp. 1-6. [9] Siol S., et al., Combinatorial In Situ photoelectron spectroscopy investigation of Sb₂Se₃/ZnS heterointerfaces. Adv. Mater. Interfaces. 2016. V. 3. N 13. P. 1600755(5). [10] Zhou Y., et al., Solution-processed Antimony Selenide heterojunction solar cells. Adv. Energy Mater. 2014. V. 4. N. 8. P. 1301846(8). [11] Разыков Т.М., Кучкаров К.М., Эргашев Б.А., и др. Получение и физические свойства пленок SnSe для использования в тонкопленочных солнечных элементах. Гелиотехника. 2017. № 2. [12] Yuan C., et al., Rapid thermal process to fabricate Sb₂Se₃ thin film for solar cell application. Solar Energy. 2016. V. 137 (1). pp. 256-260.

¹Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз

Дата поступления

²Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз

28.07.2017

a.a.mavlonov@gmail.com